単結晶標的を利用した陽電子生成実験

諏訪田 剛 (tsuyoshi.suwada@kek.jp) 加速器研究施設, KEK



Collaboration 佐藤政則、古川和朗、杉村高志、紙谷琢哉、 吉田勝英、 加速器研究施設, KEK 奥野英城、 素粒子原子核研究所, KEK 梅森健成、 物質構造科学研究所, KEK 原順一、藤本紘行、浜津良輔、 東京都立大学理学研究科 A.P.Potylitsin, I.E.Vnukov, I.S.Tropin NPI, Tomsk Polytechnic University R.Chehab, LAL, IN2P3-CNRS, Universite de Paris-Sud



Motivation

- 次世代Bファクトリー、リニアコライダー における大強度陽電子源への応用可能性を 探る
- 特に、重金属標的(非晶質)の熱負荷による損傷が回避できる陽電子源が要求される

● 単結晶標的を利用した新しい陽電子生成



Introduction

単結晶標的を利用した新しい陽電子生成法の提唱

(R. Chehab, *et al.*, PAC'89, Chicago, IL, USA, Mar. 1989, p.283)

タングステン結晶標的を利用した陽電子生成の原理実証実験@旧核研ES(1.2GeV電子)
(K. Yoshida, *et al.*, Phys. Rev. Lett. 80, 1437, 1998)

Channeling Radiation & Coherent Bremsstrahlung Processes



30/Mar,2004

Grystal W Amorphous W Amorphous W Amorphous V Fig. 4. Photon spectra for an amorphous target (darkened area) and for a crystal both of 1 mm thickness. E⁻ = 2 GeV. Cut-off energy 10 MeV. (a) 入射電子エネルギー2GeV の場合



(b) 入射電子エネルギー20GeV の場合

New Positron Production Schemes



Crystal Targets

	Crystal	Elem.	Denom.	Thickness	\mathbf{X}_{0}
				[mm]	
標的構造 (b)	Diamond	С	5mmDia	4.57	0.0372
	Silicon	Si	10mm <i>Si</i>	9.9	0.1058
	Silicon	Si	30mm <i>Si</i>	29.9	0.319
標的構造 (a)	Silicon	Si	50mm <i>Si</i>	48.15	0.514
	Tungsten	W_{c}	2.2 mm W_c	2.2	0.629
	Tungsten	W_{c}	5.3 mm W_c	5.3	1.51
	Tungsten	W_{c}	9mm <i>W</i> _c	9.0	2.57



Experimental Setup



Acceptance of the Positron Spectrometer

Pe+	Acceptance ($\Delta P \Delta \Omega$)		幾何学的運動量アクセプタンスのGEANT3による評価
(MeV/c)	$(10^{-4} \text{ x (MeV/c)} \cdot \text{sr})$		運動量アクセプタンス
5	1.08 ± 0.03		△P/P=2.4% (FWHM)
10	2.47 ± 0.07		幾何学的アクセプタンス
15	3.80 ± 0.1		$\Delta \Omega$ =1msr at Pe+=20MeV/c.
20	4.81 ± 0.12	•	次世代リニアコライアー陽電子 アクセプタンスの3%に対応

Experimental Condition/Electron Beam

Electron Beam:

- Beam Energy 8 GeV
- Angular Spread ~22 µrad (H), ~44 µrad (V)
- Transverse Beam Size ~0.8mm (FWHM) in diameter
- Beam Charge 0.1 nC/bunch
- Bunch Length (Single Bunch) ~9 ps (FWHM)
- Beam Repetition 25Hz
- Angular Spread of the Electron Beam at the Positron Target
- Φ ~ 55 µrad < Φc (Φ : beam divergence & multiple scattering at a beam window(30µm-thick SUS))

Critical Angle for the Channeling Condition at the Positron Target

- Linhard Crytical Angles ($\Phi c = (2U/E)^{1/2}$, U:Potential depth of atomic field)
- $\Phi c \sim 170 \mu rad$ @8 GeV for Silicon Crystal
- $\Phi c \sim 130 \mu rad$ @8 GeV for Diamond Crystal

Experimental Results: 2-Dimensional Axis Scan for 30-mm thick Si Crystal at Ee==8 GeV (Pe+=20MeV/c)



Experimental Results: Rocking Curves (Axis <110>) for 5mm-thick Diamond and 30mm-thick Si Crystals at Ee==8 GeV (Pe+=20MeV/c)



Experimental Results: Variations in the enhancement $(N_{e+@peak}/N_{e+@base})$ & Momentum dependence of the e+ yield at Ee=8 GeV (Pe+=20MeV/c)



Experimental Results: Variations of the e+ production yield for the onaxis crystal targets at Ee-=8 GeV (Pe+=20MeV/c)



Conclusions

まとめ

- KEK-8GeV電子陽電子入射器において、系統的な結晶標的に よる陽電子生成データを取得した
- 標的厚が薄いときは、結晶効果により高い陽電子増大度を示 すが、結晶厚が厚くなると増大度は急速に減少する
- 軽元素結晶標的(Diamond, Silicon)による陽電子生成が最大 となる最適標的厚での生成効率は、非晶質標的と同程度にな るが(Diamond/Silicon/Tungsten標的:3/6/26%増)、結晶効果 による有効放射長の短縮を確認した(非晶質タングステンに 対しDiamond/Silicon/Tungsten標的:0.7/0.8/0.5培)
- Diamond標的の単位放射長当たりの陽電子生成効率は、 Silicon標的に比べ20%程度高い

今後の方針

- 厚いダイヤモンド標的(10mm以上)による陽電子生成実験
- シミュレーションによるチャネリング/干渉性制動放射の放 射素過程の理解
- チャネリング放射光の系統的な測定(角度分布、エネルギ-分 布)



Future Plan

- ✓ 原理実証実験(吉田等)
- ✓ <u>系統的な実験データの蓄積</u>(標的の種類、標的厚 さ、標的スキーム、etc.)
- 大強度陽電子源(生成標的、収集部、加速部を含む)設計のための信頼性の高いシミュレーション コードの開発(現在進行中)
- ✓ シミュレーションによる陽電子源の最適化

⇒ 実用可能性の判断

 ✓ 実用化に向けた開発(高品質結晶の製作、標的の 冷却構造、標的の放射線損傷、熱負荷の問題)
⇒ 実用化に向けた実験的検証

Experimental Results: 2-Dimensional Axis Scan for 5mm-thick Diamond Crystal at Ee=8 GeV (Pe+=20MeV/c)



Experimental Results: Variations in the width of the rocking-curve peak for Ee-=8 GeV (Pe+=20MeV/c)



Linac Beam Line at the 3rd switch yard



Experimental Setup (cont'd):Photo picture of a crystal target on a goniometer



Experimental Setup (cont'd):Photo picture of crystal & amorphous targets



Experimental Setup (cont'd):Positron spectrometer

